43890-559 T. Komatsu et al. January 22, '02

日本 国 特 許 庁 McDermott, Will & Emery JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

2001年 1月22日

出 願 番 号 Application Number:

特願2001-012774

出 願 人
Applicant(s):

113

松下電器産業株式会社

2001年11月 2日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office





特2001-012774

【書類名】 特許願

【整理番号】 2913030015

【提出日】 平成13年 1月22日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G09G 3/30

H05B 33/26

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 小松 隆宏

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 行徳 明

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 濱野 敬史

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 金子 信一郎

【特許出願人】

【識別番号】 000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100097445

【弁理士】

【氏名又は名称】 岩橋 文雄

【選任した代理人】

【識別番号】

100103355

【弁理士】

【氏名又は名称】 坂口 智康

【選任した代理人】

【識別番号】 100109667

【弁理士】

【氏名又は名称】 内藤 浩樹

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011305

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1 ′

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9809938

【書類名】 明細書

【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス表示素子

【特許請求の範囲】

【請求項1】基板上に、少なくとも、正孔を注入する陽極と、発光領域を有する発光層と、電子を注入する陰極とを備えた有機エレクトロルミネッセンス表示素子であって、

前記陽極又は陰極を、その積層面積を第(n-1)層>第n層なる関係で、互いに絶縁してn層積層することで表示領域をn分割し、前記表示領域毎に駆動することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示素子。

【請求項2】基板上に、少なくとも、正孔を注入する陽極と、発光領域を有する発光層と、電子を注入する陰極とを備えた有機エレクトロルミネッセンス表示素子であって、

前記陽極又は陰極を、絶縁層を介して階段状にn層積層し、表示領域をn分割 して、前記表示領域毎に駆動する事を特徴とする有機エレクトロルミネッセンス 表示素子。

【請求項3】基板上に、少なくとも、正孔を注入する陽極と、発光領域を有する発光層と、電子を注入する陰極とを備えた有機エレクトロルミネッセンス表示素子であって、

前記陽極又は陰極を少なくとも2層以上積層することによって、表示領域を2 つ以上に分割した事を特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示素子。

【請求項4】前記陽極と前記陰極はストライプ状であって、互いに異なる方向 に配設されたことを特徴とする請求項1~3いずれか1記載の有機エレクトロル ミネッセンス表示素子。

【請求項5】前記陽極又は陰極と外部回路との接点において、前記陽極又は陰極がそれぞれ同一平面上に配置されたことを特徴とする請求項1~4いずれか1記載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子。

【請求項6】前記陽極又は陰極を積層することで表示領域を分割した請求項1 ~5記載いずれか1記載の表示素子を、同一平面状に複数個配置したことを特徴 とする有機エレクトロルミネッセンス表示素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、種々の表示装置や表示装置の光源又はバックライト、若しくは光通信機器に使用される発光素子等に用いられる有機エレクトロルミネッセンス表示素子に関し、特にマトリクス駆動される有機エレクトロルミネッセンス表示素子に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

エレクトロルミネッセンス素子とは、固体蛍光性物質の電界発光を利用した発 光デバイスであり、これまでは主に無機系材料を発光体として用いた無機エレク トロルミネッセンス素子が実用化され、液晶ディスプレイのバックライト等に利 用されてきた。

[0003]

一方、有機材料を用いたエレクトロルミネッセンス素子についても古くから様々な検討が行われてきたが、発光効率が非常に悪いことから本格的な実用化研究へは進展しなかった。

[0004]

しかし、1987年にコダック社のC. W. Tangらにより、有機材料を正 孔輸送層と発光層の2層に分けた機能分離型の積層構造を有する有機エレクトロルミネッセンス素子が提案され、10 V以下の低電圧にもかかわらず1000 c d / m 2 以上の高い発光輝度が得られることが明らかとなった [C. W. Tang and S. A. Vanslyke: Appl. Phys. Lett, 51 (1987) 913 等参照]。これ以降、有機エレクトロルミネッセンス素子が俄然注目され始め、同様な機能分離型の積層構造を有する有機エレクトロルミネッセンス素子についての研究が盛んに行われるようになり、現在では一部で実用化されるまでになった。

[0005]

ここで、一般的な有機エレクトロルミネッセンス素子の構成について図7を用

いて説明する。

[0006]

図7は一般的な有機エレクトロルミネッセンス素子の要部断面図である。

[0007]

図7において、1は基板、2は陽極、3は有機薄膜層、4は正孔輸送層、5は 発光層、6は陰極である。

[0008]

図7に示すように有機エレクトロルミネッセンス素子は、ガラス等の透明または半透明の基板上にスパッタリング法や抵抗加熱蒸着法等により形成されたIT O等の透明な導電性膜からなる陽極2と、陽極2上に同じく抵抗加熱蒸着法等により形成されたN,N'ージフェニルーN,N'ービス(3ーメチルフェニル)ー1,1'ージフェニルー4,4'ージアミン(以下、TPDと略称する)等からなる正孔輸送層4と、正孔輸送層4上に抵抗加熱蒸着法等により形成された8ーHydroxyquinoline Aluminum(以下、Alq3と略称する。)等からなる発光層5と、発光層5上に抵抗加熱蒸着法等により形成された100nm~300nmの膜厚の金属膜からなる陰極6と、を備えている。

[0009]

上記構成を有する有機エレクトロルミネッセンス素子の陽極2をプラス極、また陰極6をマイナス極として直流電圧又は直流電流を印加すると、陽極2から正孔輸送層4を介して発光層5に正孔が注入され、陰極6から発光層5に電子が注入される。発光層5では正孔と電子の再結合が生じ、これに伴って生成される励起子が励起状態から基底状態へ移行する際に発光現象が起こる。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】

このような有機エレクトロルミネッセンス素子を表示素子として使用する場合、一般に陽極と陰極を互いに交差する方向に配置した、いわゆるドットマトリクスパネルを形成する必要がある。

[0011]

このドットマトリクスパネルの駆動方法は、特開平9-139286号公報に

開示されているようなTFTを画素毎に配置し、画素一つ一つを個別に制御するアクティブマトリクス方式(以下AM方式と言う。)と、TFTを使用せず1ラインづつ線順次駆動するパッシブマトリクス方式(以下PM方式と言う。)の2つに分けられる。

[0012]

有機エレクトロルミネッセンス素子はその応答速度が非常に速いため、どちらの方式であっても基本的に表示品質には全く違いがないが、PM方式ではAM方式のようなTFTを使用する必要がないため工数が少なく、低コスト化が可能であるという利点を有している。しかしながら消費電力ではAM方式の方が有利であり、これは画素数が多くなる程顕著に現れる。

[0013]

ここで、この理由について図8を用いて簡単に説明する。

[0014]

図8は一般的なPM方式有機エレクトロルミネッセンス表示素子の模式図である。図8において2は陽極、6は陰極であり、この2つの電極の間に有機薄膜層が成膜されており、各電極の交点部分が1つの画素として発光する。このような表示素子の任意の画素を発光させ表示を行うためには、陰極側を1本づつ走査し、発光させたい画素に対応するデータラインのみを同時にオンにする必要がある

[0015]

そのためPM方式では1ラインを発光させる時間は(フレーム時間/陰極数)、デューティーは約(1/陰極の数)となり、瞬間輝度としてはその逆数、すなわち(陰極の数)倍の明るさが必要となる。通常の有機エレクトロルミネッセンス素子は駆動電流と発光輝度が比例関係にあるが、これは発光輝度が低い場合であり、陰極数が多く大きな瞬間輝度が必要になる高電流領域ではこの比例関係が崩れより多くの電流が必要となる。そのため、画素数が多くなり必要輝度が高くなればなるほどAM方式とPM方式との消費電力差は大きくなってしまう。また発光に必要な電力だけでなく、有機エレクトロルミネッセンス素子をPM方式で駆動させたときに特有な問題であるクロストークの発生も消費電力に大きく係わ

ってくる。

[0016]

このクロストークは発光させるために選択されたラインだけでなく周囲の非選択のラインでも発光してしまう現象であり、この対策として特開平4-308687号公報に開示されているように非選択ラインに選択ライン(発光ライン)とは逆方向の電圧をかける逆バイアス法が知られている。この逆バイアスに消費される電力もAM方式とPM方式の消費電力差の大きな要因となってしまう。

[0017]

そこでPM方式では画素数が多くなる程消費電力が大きくなり、その対策として時間輝度を低減することで低消費電力化が図られている。

[0018]

また、特開2000-29432号公報に開示されているように、画素を複数の電極用配線に分けて接続し、その配線数に分割して駆動する方法も提案されているが、分割数が増加するほど配線スペースが広くなり、発光領域が減少してしまうという課題を有していた。

[0019]

本発明は上記課題を解決するものであり、PM方式での消費電力を低減し、安価で低消費電力な有機エレクトロルミネッセンス表示素子を提供することを目的とする。

[0020]

【課題を解決するための手段】

本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、陽極又は陰極を積層し電極の取出し方向を多数化することで表示素子を多分割駆動することができ、これによりデューティーが小さくなりPM方式の低消費電力化が可能となる。

[0021]

即ち、本発明は、基板上に、少なくとも、正孔を注入する陽極と、発光領域を有する発光層と、電子を注入する陰極とを備えた有機エレクトロルミネッセンス表示素子であって、陽極又は陰極を、その積層面積を第(n-1)層>第n層なる関係で、互いに絶縁してn層積層することで表示領域をn分割し、表示領域毎

に駆動する構成としたものである。

[0022]

【発明の実施の形態】

本発明の請求項1に記載の発明は、基板上に、少なくとも、正孔を注入する陽極と、発光領域を有する発光層と、電子を注入する陰極とを備えた有機エレクトロルミネッセンス表示素子であって、陽極又は陰極を、その積層面積を第(n-1)層>第 n層なる関係で、互いに絶縁して n層積層することで表示領域を n分割し、表示領域毎に駆動することを特徴としたものであり、第(n-1)層上の第 n層が積層されていない部分と、第 n層の部分とに表示領域を分け、この多分割化により表示素子駆動時のデューディーを小さくして PM方式の低消費電力化を図ることができる。なお、n は整数であり、n > 1 である。

[0023]

本発明の請求項2に記載の発明は、基板上に、少なくとも、正孔を注入する陽極と、発光領域を有する発光層と、電子を注入する陰極とを備えた有機エレクトロルミネッセンス表示素子であって、陽極又は陰極を、絶縁層を介して階段状に n層積層し、表示領域をn分割して、表示領域毎に駆動する事を特徴としたものであり、階段状とすることで多分割化が可能となり、これにより表示素子駆動時のデューティーを小さくしてPM方式の低消費電力化を図ることができる。なお、nは整数であり、n>1である。

[0024]

本発明の請求項3に記載の発明は、基板上に、少なくとも、正孔を注入する陽極と、発光領域を有する発光層と、電子を注入する陰極とを備えた有機エレクトロルミネッセンス表示素子であって、陽極又は陰極を少なくとも2層以上積層することによって、表示領域を2つ以上に分割した事を特徴としたものであり、配線により表示領域を減少することなく、表示領域の多分割化が可能となり、表示素子駆動時のデューディーを小さくし、PM方式の低消費電力化を図ることができる。

[0025]

本発明の請求項4に記載の発明は、請求項1~3において、陽極と陰極はスト

ライプ状であって、互いに異なる方向に配設されたことを特徴としたものであり、表示領域の多分割化により表示素子駆動時のデューディーを小さくし、PM方式の低消費電力化を図った表示素子を提供することができる。

[0026]

本発明の請求項5に記載の発明は、請求項1~4において、陽極又は陰極と外部回路との接点において、陽極又は陰極がそれぞれ同一平面上に配置されたことを特徴としたものであり、平面に配置することにより外部回路との接続を容易にし、また信頼性も向上することができる。

[0027]

本発明の請求項6に記載の発明は、請求項1~5において、陽極又は陰極を積層することで表示領域を分割した表示素子を、同一平面状に複数個配置したことを特徴としたものであり、これにより更なる多分割化が可能となり表示素子駆動時のデューティーを小さくしてPM方式の低消費電力化を図ることができる。

[0028]

即ち、例えば、n分割された表示素子を同一平面状にm個配置することで、全表示素子は $n \times m$ 個に分割される。なお、n、mは整数であり、n > 1、m > 1 である。

[0029]

以下、本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示素子について、詳細に説明する。

[0030]

本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示素子に用いられる基板としては、 機械的、熱的強度を有し、透明又は半透明であれば特に限定されるものではない

[0031]

例えば、ガラス基板や、ポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリメチルメタクリレート、ポリエーテルスルフォン、ポリフッ化ビニル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアクリレート、非晶質ポリオレフィン、フッ素系樹脂等の可視光領域について透明度の高い材料を用いることができ、これらの材

料をフィルム化した可撓性を有するフレキシブル基板であっても良い。

[0032]

また、用途によっては特定波長のみを透過する材料、光一光変換機能をもった特定の波長の光へ変換する材料などであってもよい。また、基板は絶縁性であることが好ましいが、特に限定されるものではなく、有機エレクトロルミネッセンス表示素子の駆動を妨げない範囲、或いは用途によって、導電性を有していても良い。なお、本発明において、透明または半透明なる定義は、有機エレクトロルミネッセンス表示素子による発光の視認を妨げない程度の透明性を示すものである。

[0033]

上記有機エレクトロルミネッセンス素子(表示素子)の陽極としては、ITO、ATO(S b をドープした S n O₂)、AZO(A 1 をドープした Z n O)等が用いられる。

[0034]

また、有機薄膜層は、発光層のみの単層構造の他に、正孔輸送層と発光層又は 発光層と電子輸送層の2層構造や、正孔輸送層と発光層と電子輸送層の3層構造 のいずれの構造でもよい。但し、このような2層構造又は3層構造の場合には、 正孔輸送層と陽極が、又は電子輸送層と陰極が接するように積層して形成される

[0035]

また、発光層としては、可視領域で蛍光特性を有し、かつ成膜性の良い蛍光体からなるものが好ましく、 $A1q_3$ や $Be-ベンゾキノリノール(BeBq_2)の他に、2,5-ビス(5,7-ジーt-ペンチルー2-ベンゾオキサゾリル)ー1,3,4-チアジアゾール、4,4'-ビス(5,7-ベンチルー2-ベンゾオキサゾリル)スチルベン、4,4'-ビス〔5,7-ジー(2-メチルー2ーブチル)ー2-ベンゾオキサゾリル〕スチルベン、2,5-ビス(5,7-ジーt-ベンチルー2-ベンゾオキサゾリル)チオフィン、2,5-ビス(<math>[5-\alpha,\alpha-ジメチルベンジル]-2-ベンゾオキサゾリル)チオフェン、2,5-ビス〔5,7-ジー(<math>[5-\alpha,\alpha-i]$

, 4 - ジフェニルチオフェン、2, 5 - ビス(5 - メチル-2 - ベンゾオキサゾ リル)チオフェン、4,4'ービス(2ーベンゾオキサイゾリル)ビフェニル、 5-メチルー2- [2- [4-(5-メチルー2-ベンゾオキサイゾリル)フェ ニル〕ビニル〕ベンゾオキサイゾリル、2- [2-(4-クロロフェニル)ビニ ル] ナフト〔1, 2-d〕オキサゾール等のベンゾオキサゾール系、2, 2'-(p-フェニレンジビニレン)ービスベンゾチアゾール等のベンゾチアゾール系 、2-〔2-〔4-(2-ベンゾイミダゾリル)フェニル〕ビニル〕ベンゾイミ ダゾール、2- [2-(4-カルボキシフェニル) ビニル] ベンゾイミダゾール 等のベンゾイミダゾール系等の蛍光増白剤や、トリス(8-キノリノール)アル ミニウム、ビス(8-キノリノール)マグネシウム、ビス(ベンゾ〔f〕-8-キノリノール) 亜鉛、ビス(2-メチル-8-キノリノラート) アルミニウムオ キシド、トリス(8-キノリノール)インジウム、トリス(5-メチル-8-キ ノリノール)アルミニウム、8-キノリノールリチウム、トリス (5-クロロー 8-キノリノール) ガリウム、ビス (5-クロロ-8-キノリノール) カルシウ ム、ポリ〔亜鉛ービス(8-ヒドロキシー5-キノリノニル)メタン〕等の8-ヒドロキシキノリン系金属錯体やジリチウムエピンドリジオン等の金属キレート 化オキシノイド化合物や、1, 4-ビス(2-メチルスチリル) ベンゼン、1, 4-(3-メチルスチリル) ベンゼン、1, 4-ビス (4-メチルスチリル) ベ ンゼン、ジスチリルベンゼン、1,4-ビス(2-エチルスチリル)ベンゼン、 1, 4-ビス(3-エチルスチリル) ベンゼン、<math>1, 4-ビス(2-メチルスチリル)2-メチルベンゼン等のスチリルベンゼン系化合物や、2,5-ビス(4 ーメチルスチリル) ピラジン、2,5-ビス(4-エチルスチリル) ピラジン、 2, 5-ビス [2-(1-ナフチル) ビニル] ピラジン、2, <math>5-ビス (4-メトキシスチリル) ピラジン、2, 5-ビス〔2-(4-ビフェニル) ビニル〕ピ ラジン、2, 5-ビス〔2-(1-ピレニル)ビニル〕ピラジン等のジスチルピラジン誘導体や、ナフタルイミド誘導体や、ペリレン誘導体や、オキサジアゾー ル誘導体や、アルダジン誘導体や、シクロペンタジエン誘導体や、スチリルアミ ン誘導体や、クマリン系誘導体や、芳香族ジメチリディン誘導体等が用いられる 。さらに、アントラセン、サリチル酸塩、ピレン、コロネン等も用いられる。

[0036]

また、正孔輸送層としては、正孔移動度が高く、透明で成膜性の良いものが好 ましくTPDの他に、ポルフィン、テトラフェニルポルフィン銅、フタロシアニ ン、銅フタロシアニン、チタニウムフタロシアニンオキサイド等のポリフィリン 化合物や、1,1-ビス{4-(ジーP-トリルアミノ)フェニル}シクロヘキ サン、4, 4', -トリメチルトリフェニルアミン、N, N', N' ーテトラキス (Pートリル) - P - フェニレンジアミン、1 - (N, N - ジ- P . - トリルアミノ) ナフタレン、4,4' ービス(ジメチルアミノ) - 2 - 2' -ジメチルトリフェニルメタン、N, N, N', N'-テトラフェニルー4, 4' ージアミノビフェニル、N、N'ージフェニルーN、N'ージーmートリルー4 、4'-ジアミノビフェニル、N-フェニルカルバゾール等の芳香族第三級アミ ンや、4-ジ-P-トリルアミノスチルベン、4-(ジ-P-トリルアミノ)-4'-〔4-(ジ-P-トリルアミノ) スチリル] スチルベン等のスチルベン化 合物や、トリアゾール誘導体や、オキサジザゾール誘導体や、イミダゾール誘導 体や、ポリアリールアルカン誘導体や、ピラゾリン誘導体や、ピラゾロン誘導体 や、フェニレンジアミン誘導体や、アニールアミン誘導体や、アミノ置換カルコ ン誘導体や、オキサゾール誘導体や、スチリルアントラセン誘導体や、フルオレ ノン誘導体や、ヒドラゾン誘導体や、シラザン誘導体や、ポリシラン系アニリン 系共重合体や、高分子オリゴマーや、スチリルアミン化合物や、芳香族ジメチリ ディン系化合物や、ポリ3ーメチルチオフェン等の有機材料が用いられる。また 、ポリカーボネート等の高分子中に低分子の正孔輸送層用の有機材料を分散させ た、高分子分散系の正孔輸送層も用いられる。

[0037]

また、電子輸送層としては、1,3-ビス(4-tert-ブチルフェニルー1,3,4-オキサジアゾリル)フェニレン(OXD-7)等のオキサジアゾール誘導体、アントラキノジメタン誘導体、ジフェニルキノン誘導体等が用いられる。

[0038]

また、陰極としては、仕事関数の低い金属もしくは合金が用いられ、A1、I

n、Mg、Ti等の金属や、Mg-Ag合金、Mg-In合金等のMg合金や、Al-Li合金、Al-Sr合金、Al-Ba合金等のAl合金等が用いられる

[0039]

以下に本発明の実施の形態について説明する。

[0040]

(実施の形態1)

本発明の一実施の形態における有機エレクトロルミネッセンス表示素子について述べる。

[0041]

図1は本発明の一実施の形態における有機エレクトロルミネッセンス表示素子の要部断面図である。

[0042]

また、図2は本発明の一実施の形態における有機エレクトロルミネッセンス表示素子の斜視図である。

[0043]

図1、図2において、基板1、有機薄膜層3、陰極6は従来の技術で説明した ものと同様のものであるので、同一の符号を付して説明を省略する。また7は第 1 陽極、8は第2 陽極、9は絶縁層である。なお、有機薄膜層3は、図示を省略 しているが、正孔輸送層4と、正孔輸送層4上に形成された発光層5とを備えて いる。

[0044]

図1、図2に示したように、本実施の形態における有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、素子構成以外の材料、形成法等は従来の素子とほぼ同じである

[0045]

本実施の形態における有機エレクトロルミネッセンス表示素子が従来の技術と 異なっているのは、第1陽極7の上部に絶縁層9及び第2陽極8が配置されてい る点である。これにより陽極の取出し方向が1方向であっても、表示領域は2つ に分割することが可能となり、デューティー、消費電力を小さくすることができる。

[0046]

そして、図1に示すように、第1陽極7と、これに絶縁層9を介して積層される第2陽極8との積層面積の関係は、(第1層の第1陽極7の積層面積)>(第2層の第2陽極8の積層面積)なる関係である。加えて、図1に示すように、第1層の第1陽極7に絶縁層9を介して第2層の第2陽極8を階段状に積層することが好ましい。また、積層数も2層に限らず、3層、4層、5層、或いはそれ以上と、積層してもよいのは言うまでもない。

[0047]

なお、本実施の形態においても、有機薄膜層3が正孔輸送層4と発光層5からなる2層構造の場合について説明したが、その構造については前述のように特にこれに限定されるものではない。

[0048]

また、この絶縁層 9 に使用される材料としては有機層からの発光を透過するものであれば SiO_2 、 TiO_2 、 Al_2O_3 等の酸化物や、 SiON 等の窒化酸化物、 AlN、 SiN 等の窒化物等どのようなものであってもよい。

[0049]

そして、本実施の形態における有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、表示領域をn分割して、そのn分割された表示領域毎に駆動する場合でも、陽極を互いに絶縁してn層積層することによって、陽極の取り出し方向は1方向とすることができるので、外部回路との接続が容易である。

[0050]

また、図2に示すように、第1陽極7と第2陽極8は絶縁層9を介して積層されているが、その端部の取り出しにおいては、それぞれ基板1の同一平面上に配置されている。このように配置することにより、図示しない外部回路との接続を容易にし、また信頼性も向上することができる。

[0051]

なお、本実施の形態においては、陽極を第1陽極7と第2陽極8に互いに絶縁

層9にて絶縁して積層して表示領域を分割し、この表示領域毎に駆動するものであるが、陰極を互いに絶縁して積層し、表示領域を分割し、この表示領域毎に駆動するものであってもよいことは言うまでもない。

[0052]

次に、本発明の一実施の形態における有機エレクトロルミネッセンス表示素子の製造方法について説明する。

[0053]

図3は本発明の一実施の形態における有機エレクトロルミネッセンス表示素子の製造工程毎の積層状態を示す斜視図である。図3において、10はガラス基板、11はレジストを示している。

[0054]

まずスパッタリング法により、ガラス基板10上に膜厚160nmのITO膜を形成した後、ITO膜上にレジスト材(東京応化社製、OFPR-800)をスピンコート法により塗布して厚さ10μmのレジスト膜を形成し、マスク、露光、現像してレジスト膜を所定の形状にパターニングした。次に、このガラス基板を60℃で50%の塩酸中に浸漬して、レジスト膜が形成されていない部分のITO膜をエッチングした後、レジスト膜も除去し、ライン数=176、ピッチ=0.198mmのパターンのITO膜からなる第1陽極7が形成されたガラス基板を得た(図3(a)に示す)。

[0055]

次に、このガラス基板10上にスパッタリング法によってA1N膜を5nm、続いて SiO_2 膜を50nm成膜し絶縁層9を形成した(図3(b)に示す)。

[0056]

さらにITO膜を成膜した後、前記第1陽極7のパターニング法と同様の方法で第1陽極7と同パターンの第2陽極8を形成した(図3(c)に示す)。

[0057]

その後レジスト11にて第2陽極8の約半分を被覆し(図3 (d) に示す)、 弗化水素で SiO_2 膜を、またリアクティブイオンエッチングによってA1Nを 取り除いた(図3 (e) に示す)。 [0058]

最後にレジスト11を除去することによって第1陽極7上部に、絶縁層9によって隔離された第2陽極8を有するガラス基板10を得た(図3(f)に示す)

[0059]

また、以降の工程は図示していないが、次に、このガラス基板10を、洗剤(フルウチ化学社製、セミコクリーン)による5分間の超音波洗浄、純水による10分間の超音波洗浄、アンモニア水1(体積比)に対して過酸化水素水1と水5を混合した溶液による5分間の超音波洗浄、70℃の純水による5分間の超音波洗浄の順に洗浄処理した後、窒素ブロアーでガラス基板10に付着した水分を除去し、さらに250℃に加熱して乾燥した。

[0060]

以上のようにして第1陽極7、第2陽極8が形成されたガラス基板10上に、特開平11-121168号公報に開示されたのと同様にして、 Cr_2O_3 とレジストを用いて第1陽極7、第2陽極8と交差する方向に陰極6をライン数=220、ピッチ=198mmで分断するための隔壁を形成した。

[0061]

次に、ガラス基板10の第2陽極8側の表面に、2×10⁻⁶Torr以下の真空度まで減圧した抵抗加熱蒸着装置内にて、正孔輸送層4としてTPDを約50nmの膜厚で形成した。

[0062]

さらに、同様に抵抗加熱蒸着装置内にて、正孔輸送層 4 上に発光層 5 として 1 q_3 を約 6 0 n mの膜厚で形成した。なお、T P D と A 1 q_3 の蒸着速度は、共に 0. 2 n m / s であった。

[0063]

次に、同様に抵抗加熱蒸着装置内にて、発光層5上に15at%のLiを含むA1-Li合金を蒸着源として、陰極6を150nmの膜厚で成膜した。

[0064]

以上のようにして形成した有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、陽極が

2つに分割されていることから表示部は2分割で駆動することが可能である。

[0065]

また、更に、この2分割素子を同一平面上に2個配置することによって、全表示領域は計4分割される(2分割×2個配置=4)。この状態を図4(a)に示す。なお、図4は、同一平面上に2個の素子が配置された状態を示す概略平面図である。

[0066]

そして、この4分割素子(2分割×2個配置=4)、及び、同様にして作製した6分割素子(3分割×2個配置=6、図4(b)に示す)、さらに陽極を積層せず2個配置したのみの2分割素子(1×2個配置=2、図4(c)に示す)のそれぞれのデューティー及び消費電力を図5に示す。

[0067]

なお、図5は、本発明の一実施の形態における有機エレクトロルミネッセンス 表示素子の分割数とデューティー及び消費電力との関係を示すグラフである。

[0068]

図5より明らかなように、分割数を多くすることによりデューティーは小さくなり、消費電力の低減が可能となった。

[0069]

また、陽極を積層することによる発光色の変化も懸念されたが、6分割までは ITOによる変色はほとんどなかった。

[0070]

(実施の形態2)

次に、本発明の一実施の形態における有機エレクトロルミネッセンス表示素子 の他の製造方法について説明する。

[0071]

[0072]

まずスパッタリング法により、ガラス基板10上に膜厚160nmの第1ITO膜12、100nmの SiO_2 膜13、160nmの第2ITO膜14を順次積層した(図6(a)に示す)後、上部ITO膜上にレジスト材11(東京応化社製、OFPR-800)をスピンコート法により塗布して厚さ10 μ mのレジスト膜を形成し、マスク、露光、現像してレジスト膜11を所定の形状にパターニングした(図6(b)に示す)。

[0073]

次に、このガラス基板10を、レジスト膜11をマスクにしてリアクティブイオンエッチングによりエッチングし、マスキングしていない部分の1TO膜12,14及び SiO_9 膜13を除去した(図6(c)に示す)。

[0074]

続いてレジスト膜11を除去し、再度全面に同様のレジスト膜11を塗布し、パターニングによりその半分を残した(図6(d)に示す)。

[0075]

さらにこのレジスト膜 1 1 で覆われていない部分の S i O_2 膜 1 3 及び第 2 I T O膜 1 4 を同じくリアクティブイオンエッチング法により除去したのち(図 6 (e) に示す)、レジスト膜 1 1 を剥離することで第 1 I T O膜 1 2 (第 1 陽極)上部に、S i O_2 膜 1 3 (絶縁層)によって隔離された第 2 I T O膜 1 4 (第 2 陽極)を有するガラス基板 1 0 を得た(図 6 (f)に示す)。

[0076]

このようにして作製した基板を使用し、分割数を多くすることによってもデューティーは小さくなり、実施の形態1と同様の低消費電力化が可能となった。

[0077]

【発明の効果】

以上のように、本発明によれば、線順次駆動にて駆動される有機エレクトロルミネッセンス表示素子において、電極の分割数を多くすることにより、低コストで低消費電力の表示素子を提供することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の一実施の形態における有機エレクトロルミネッセンス表示素子の要部 断面図

【図2】

本発明の一実施の形態における有機エレクトロルミネッセンス表示素子の斜視 図

【図3】

本発明の一実施の形態における有機エレクトロルミネッセンス表示素子の製造 工程毎の積層状態を示す斜視図

【図4】

同一平面上に2個の素子が配置された状態を示す概略平面図

【図5】

本発明の一実施の形態における有機エレクトロルミネッセンス表示素子の分割 数とデューティー及び消費電力との関係を示すグラフ

【図6】

本発明の一実施の形態における有機エレクトロルミネッセンス表示素子の製造 工程毎の積層状態を示す図

【図7】

一般的な有機エレクトロルミネッセンス素子の要部断面図

【図8】

一般的なPM方式有機エレクトロルミネッセンス表示素子の模式図

【符号の説明】

- 1 基板
- 2 陽極
- 3 有機薄膜層
- 4 正孔輸送層
- 5 発光層
- 6 陰極
- 7 第1陽極

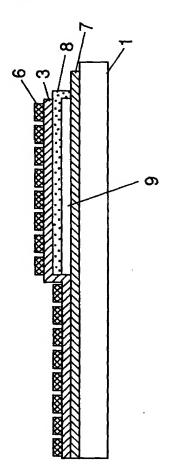
特2001-012774

- 8 第2陽極
- 9 絶縁層
- 10 ガラス基板
- 11 レジスト
- 12 第1ITO膜
- 13 SiO₂膜
- 14 第2ITO膜

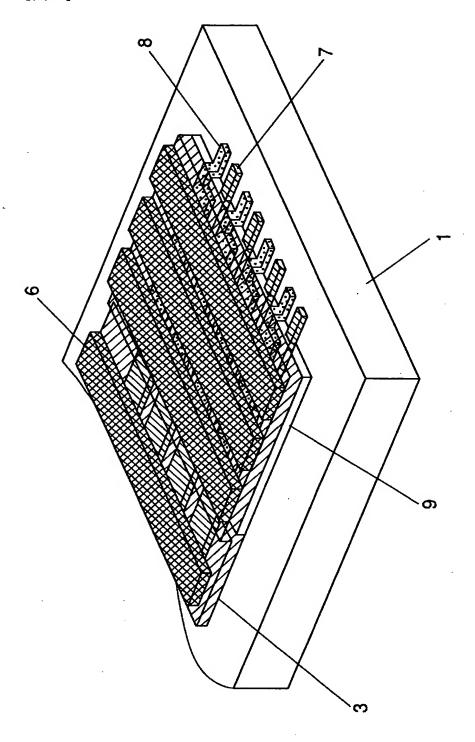
【書類名】

図面

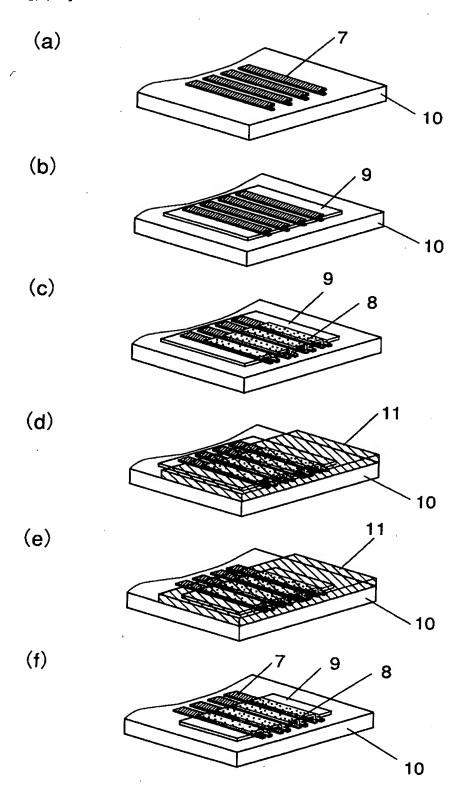
【図1】



【図2】

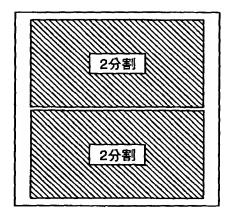


【図3】

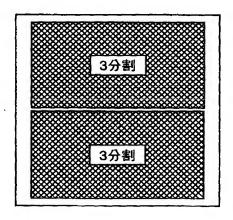


【図4】

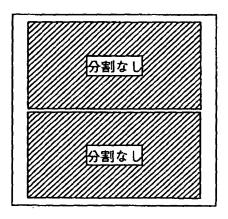
(a)



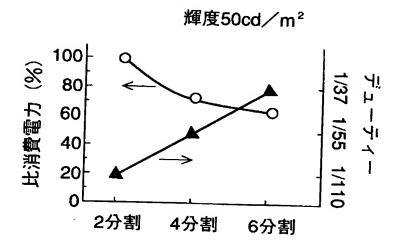
(b)



(c)

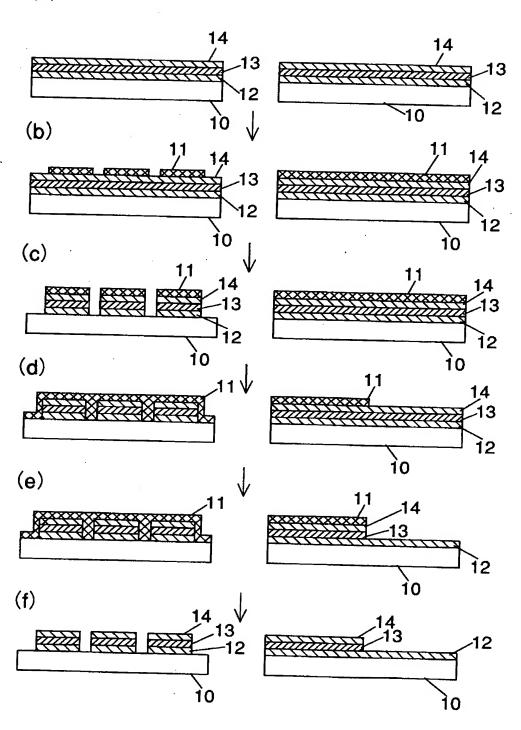


【図5】



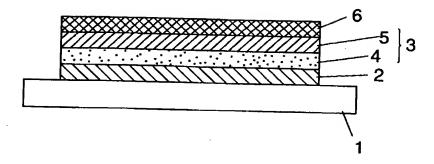
【図6】

(a)

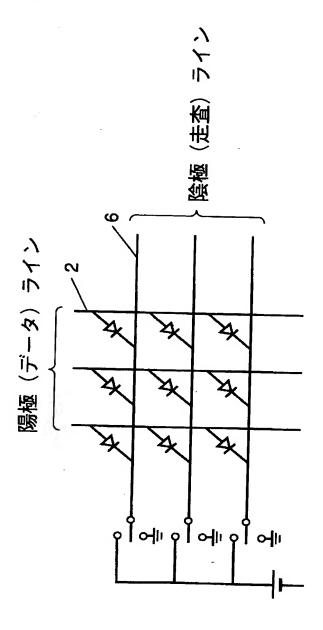




【図7]



【図8】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 本発明は、PM方式での消費電力を低減し、安価で低消費電力な有機エレクトロルミネッセンス表示素子を提供することを目的とする。

【解決手段】 本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示素子は、基板上に、少なくとも、正孔を注入する陽極と、発光領域を有する発光層と、電子を注入する陰極とを備えた有機エレクトロルミネッセンス表示素子であって、陽極又は、陰極を、その積層面積を第(n-1)層>第 n 層なる関係で、互いに絶縁して n 層積層することで表示領域を n 分割し、表示領域毎に駆動する構成とした。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日 1990年 8月28日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府門真市大字門真1006番地

氏 名 松下電器産業株式会社